

平成 29 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 S U M C O 代表者名 代表取締役 会長兼CEO 橋本 眞幸(コード: 3 4 3 6 東 証 第 一 部 ) 問合せ先 広 報 · I R 室 長 澁谷 博史(TEL. 0 3 - 5 4 4 4 4 - 3 9 1 5 )

## 設備投資(固定資産の取得)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、設備投資を実施することについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 設備投資の理由

300mm シリコンウェーハは、今後ますます市場が伸長する見通しであります。その中でも最先端半導体用高精度ウェーハは今後、最も需要が増加する見込みでありますが、サプライヤーの数も限られていることから、特に需給がひっ迫すると予測されます。このような状況下、当社は市場シェアの高い 300mm 最先端半導体用高精度ウェーハの供給責任を果たすために、顧客との長期販売契約に基づき、平成 31 年上期を目処に月産 11 万枚の増強投資を自己資金にて実施することを決定いたしました。

#### 2. 設備投資の内容

a) 対象資産の名称 300mm シリコンウェーハ製造設備

b) 所在地 佐賀県伊万里市

c) 投資予定額 436 億円d) 資金調達方法 自己資金

# 3. 稼動予定時期 平成 31 年上期

## 4. 今後の見通し

本設備投資による当期業績への影響はありません。

以上